IMAGE PROCESSING METHOD IN WAFER-DEFECT INSPECTION

Patent Number:

JP3013850

Publication date:

1991-01-22

Inventor(s):

WAKABAYASHI SHIGEJI; others: 01

Applicant(s):

NIPPON STEEL CORP

Requested Patent:

☐ JP3013850

Application Number: JP19890149950 19890613

Priority Number(s):

IPC Classification:

G01N21/88; G06F15/62; H01L21/66

EC Classification:

Equivalents:

JP2024326C, JP7060135B

Abstract

PURPOSE: To detect only a true defect by using the first image as a defect reference image, using the second image as an illuminance-distribution reference image, subtracting the illuminance distribution of the illuminance-distribution reference image from the illuminance distribution of the defect reference image, reducing the effect of the illuminance distribution from the defect reference image, and detecting the defect, CONSTITUTION:A color camera 7 splits incident light into three primary colors of R (red), G (green) and B (blue) through a dichroic prism. The decomposed three images are picked up at the same time, and three image signals are outputted. Of the image signals of R, G and B outputted from the color camera 7, e.g. G is made to be a defect reference image and B is made to be an illuminance-distribution reference image. The signals are inputted into an image processing device 8. The illuminance distribution of the illuminancedistribution reference image is subtracted from the illuminance distribution of the defect reference image. Thus, the effect of the illuminance distribution is reduced from the defect reference image, and the defect is detected.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑩ 日本国特許庁(JP)

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-13850

⑤Int.Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 G 01 N 21/88 E 2107-2G J 2107-2G G 06 F 15/62 4 0 5 A 8419-5B H 01 L 21/66 J 7013-5F

•

④公開 平成3年(1991)1月22日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

図発明の名称 ウエハケ陥検査の画像処理方法

②特 願 平1-149950

②出 願 平1(1989)6月13日

⑫発 明 者 若 林 茂 治 福岡県北九州市八幡東区枝光1-1-1 新日本製鐵株式

會社設備技術本部内

⑩発 明 者 平 木 克 彦 山口県光市大字島田3434番地 ニツテツ電子株式会社光工

場内

⑪出 願 人 新日本製鐵株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6番3号

砲代 理 人 弁理士 杉 信 興

玥 胡 杏

1. 発明の名称

ウェハ欠陥校変の画像処理方法

2 . 特許請求の飯囲

ウェハを撮影して得られる画像を処理して欠陥 の検査を行なうウェハ欠陥検査の画像処理方法に おいて:

少なくとも2種類の互いに異なる波長領域毎に分光して撮影された第1および第2の画像を入力し、第1の画像を欠陥参照画像とし、第2の画像を原皮分布参照画像とし、前記欠陥参照画像の照皮分布を減算することによって、前記欠陥参照画像から照度分布の影響を少なくして欠陥の検出を行なうことを特徴とする、ウェハ欠陥検査の画像処理方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、シリコンウエハ製造におけるウェ ハの欠陥の検査方法に関するものである。

〔従来の技術〕

世来、ウエハの欠陥検査は顕微鏡による目視検 査が主であったが、最近になってカメラと西像処 理装置を用い、カメラから得られる画像信号を画 像処理する検査方法が提案されている。ところが **欠陥が全くないウエハの画像であっても、 照度** (面像の明るさ) は画面全体にわたって一様均一 ではない。照度は画面の上下方向(Y軸)でも左右 方向(X輪)でもある一定の差異を持ち、その差異 は装置およびウェハの品種に固有のものであるこ とが知られている。この差異をそのままにして判 定すると実欠陥以外を欠陥として校出してしまう ちの寒影響があるので、 次のようなリファレンス 面像を使用する補正が行なわれてきた。この方法 は予めメモリにストアした欠陥の映像の標準形態 と検査対象のウエハ製品の検査結果を比較する前 に欠陥のない同じ品種でかつ同じ照度分布をもっ たりファレンス面像をメモリの中に用意し、検査 対象のウエハ製品の検査結果とリファレンス面像 を比較し照度分布を補正するものである。この方 法を第1回、第2回および第3回によって説明す

る。第1図において1はカメラで得られた画像の 範囲を示し、2は欠陥を示す点映像である。とこ ろが実際の画面にはこの欠陥による点映像だけで はなく、欠陥以外の原因による点映像も多数現わ れる。

される。その結果は、欠陥による点映像と欠陥的による点映像が現むれるが、予めさないの原因により低い点映像は欠陥と見做された。 ではない、それでも残る照度の高いにない、それでも残る照度の高いが、からにないでは、例えば特公昭61-194737 号においては、例の根準形態を予めメモリにストでは、例ののではである。であるが、リファレンス画像を利用した欠陥校室方法が、リファレンス画像を利用した欠陥校室方法である。

[発明が解決しようとする課題]

世来技術の手法では、少なくとも製造品種ロットがかわると、製造品種ロッドに適したリファレンス画像を再記憶させなければ照度分布の補正を行なうことができないため、実欠陥のみを正確に検出することができない。また、同一製造品種ロットのながでも検査対象ウエハの照度分布がリファレンス画像の照度分布と極端に変化した場合は多数検査精度が悪化し、検査作業の中断をせざるを

えない。

(問題点を解決するための手段・作用)

ウェハの一画像を、波長領域の異なるR(赤), G(緑),B(青)に分光した場合、それぞれの波長 の画像には次のような特徴があることに着目した。

- (1) G 波長(色)の画像は久陥部と欠陥部なし部の 照度変化が大きい。
- (2) B 波長(色)の画像は欠陥部と欠陥部なし部の 照度変化が小さい。
- (3) 照度分布はG. B 画像共、同一である。 したがって、G 波長(色)の画像からB 波長(色)の 画像を画面間波算することにより、照度分布の不 均一性が補正できた画像が得られる。

検査作業の中断による作業効率低下という、上述の課題を解決するために、少なくとも2種類を互いに異なる被長領域毎に分光して撮影された気質1および第2の画像を入力し、第1の画像を外路を設めるがいる。 参照画像とし、第2の画像を照度分布参照画像分布 が記欠陥参照画像の照度分布から該照度が に、前記欠陥参照画像の照度分布を減算することによって、前記 欠陥参照画像から照度分布の影響を少なくして欠陥の検出を行なうことを特徴とする、ウェハ欠陥 検査の画像処理方法を発明した。

(実施例)

使用する装置の構成を第4回にて説明する。こ の例では、微分干渉顕微鏡4によって、検査対象 のウエハ5の拡大面面を得ている。検査対象のウ エハは、ウエハが多数枚入ったウエハカセット6 から1枚ずつ微分干渉顕微鏡下に自動的に搬送さ れ検査所定位置に位置決めされる。位置決めされ ると自動焦点機構により焦点合わせが行なわれる。 焦点が合うと、微分干渉顕微鏡で得られる画像は、 カラーカメラクによって損像される。このカラー カメラは、入射光をダイクロイックプリズムによっ TR(赤),G(緑),B(青)の3原色に分光(色分解) し、分解された3つの函像を同時に撮影し、3つ の画像信号を出力する。カラーカメラから出力さ れるR,G,Bの各画像信号のうち、この例ではG とBの2つだけが、Gを欠陥参照画像。Bを照度 分布参照函像として画像処理装置8に入力され処

理される。なお、画像処理装置には、扱像した各画像の照度(明るさ)を量子化したGおよびBのデジタル信号が印加される。画像処理装置の制御はCPU 9で行なわれる。

次に、この面像処理装置の処理内容について説 明する。

それによって照皮補正されたG 画像G3の照度分布とを示す。

以上の画像処理を所定の複数検査点に対し同様に繰り返し、連続的に欠陥検査を実施する。

(発明の効果)

以上の通り本発明によれば、検査対象のウエハ の一両像自体から、欠陥を検出するための画像と が得られる。各画像情報の変化の様子を第7図に示す。B1とB2が、それぞれ前処理を受ける前と後のB画像の照度分布状態を示し、G1とG2が、それぞれ前処理を受ける前と後のG画像の照度分布状態を示している。第7図中で、ウエハの欠陥は17で示され、ウエハ上の異物は18で示される。

更に、前処理の結果得られるBの面像情報B2を第5図の減算処理13において、減算処理する。すなわち、この例ではB2の各面素の照度から20(定数)を減算し、B面像上の照度分布に対応する
照度分布の補正情報B3を生成する。なお、減算する定数は、面像B2の階調数と画像の内容に適合する値が用いられるので、20に限定されるものではない。

次に、第5図の波算処理14において、前処理されたG画像G2から波算処理14の結果符られるB画像B3を画素毎に波算する。これによって、 照度分布の不均一性が補正されたG画像G3が得 られる。第7回に照度分布を示すB画像B3と、

照度分布を補正するための画像とをとりうるので、 別途に製品ロッド毎のリファレンス画像を用意す る必要がない。また、製造品種ロッドが変わって もリファレンス画像の再入力のための欠陥検査作 業の中断がない。

4. 図面の簡単な説明

第1 図はカメラで得られた画像の様子を表す平面図、第2 図は第1 図の照度分布を3 次元座標で表した斜視図、第3 図は第2 図のリファレンス明の像の照度分布を表した斜視図、第4 図は本発明の実施例における画像処理手順を示すプロック図、第6 図は面像処理手順を示すプロック図、第6 図は画像処理するうえの画像を分割するとのである。

特許出願人 新日本製鐵株式會社代理人 弁理士 杉 倡 实验

特開平3-13850(4)







